PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

61-247743

(43) Date of publication of application: 05.11.1986

(51)Int.CI.

C08J 7/06 B32B 27/00 // CO9K 3/00 CO9K 3/18

(21)Application number: 60-088776

(71)Applicant: ASAHI GLASS CO LTD

(22)Date of filing: 26.04.1985 (72)Inventor: MATSUO HITOSHI

DOR

YAMAGISHI NOBUYUKI

(54) ANTIFOULING AND LOWLY REFLECTIVE PLASTIC

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide the title plastic which has excellent antifouling properties, low reflectiveness and resistance to marring and is suitable for use as an automotive window, by forming a coating film composed of an antireflective coating compsn. contg. a plurality of compds. fluorine and silicon atoms on the surface of a plastic.

R. - - - 6 1 I

1

Ţ

CONSTITUTION: 5W80 wt% compd. of formula I (wherein A is a bivalent org. group; X is halogen, a group of formula II, OR; R is lower alkyl; Rf1 is polyfluoroalkyl) such as the compd. of formula III. 5W94 wt% compd. of formula IV (wherein Rf2 is a fluorinated 2C or higher bivalent org. group) such as the compd. of formula V and

B & (C.R.) 18:1:0 21;

Ш

to prepare an antireflective coating compsn. The compsn. is

applied to the surface of a plastic which is pref. transparent and

ÍΥ

whose surface is pref. treated to activate it, to form a coating film, thus obtaining the desired antifouling and lowly reflective plastic.

CliBiC: H. (CP;); 1; R. Si Cl.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

Date of requesting appeal against examiner's

decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 特 許 公 報(B2)

(11)特許出願公告番号

特公平6-29332

(24) (44)公告日 平成6年(1994)4月20日

(51)Int.Cl. ⁵	識別記号	庁内整理番号	FI		技術	析表示箇所
C08J 7/06	Z					
B 3 2 B 27/00	101	7258-4F				
// C 0 9 K 3/00	112 A	8517-4H				
3/18	1 0 4	8318-4H				
					発明の数1(全	5 頁)
(21)出願番号	特願昭60-88776		(71)出願人	999999999		

(22)出願日	昭和60年(1985) 4月26日	旭硝子株式会社 東京都千代田区丸の内 2 丁目 1 番 2 号
(\		(72)発明者 松尾 仁
(65)公開番号	特開昭61-247743	神奈川県横浜市緑区荏田南 1 -20
(43)公開日	昭和61年(1986)11月5日	(72)発明者 山岸 展幸
		神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰2-59—1
		(74)代理人 弁理士 内田 明 (外1名)
		審査官 井出 隆一
		(56)参考文献 特開 昭60-40254 (JP, A) 特開 昭59-26944 (JP, A)

(54)【発明の名称】 防汚性・低反射性プラスチック

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】表面に反射防止膜が形成された低反射性プラスチックにおいて、下記一般式で表わされる化合物を含有する反射防止膜組成物からなる塗膜が形成されてなることを特徴とする防汚性・低反射性プラスチック。 一般式

R₁ -A-S1X₃

5~80重量%

X, Si-A-R, -A-SiX,

5~94重量%

SiX₄

1~90重量%

(但し、式中Aは二価の有機基、Xはハロゲン、

O || OCR \

OR、Rは低級アルキル基、R.1はポリフルオロアルキル

2

基、R_f²はフツ素を含有する炭素数2以上の二価の有機 基を示す。)

【請求項2】プラスチツクが透明プラスチツクである特許請求の範囲第1項記載の低反射性プラスチツク。

【請求項3】プラスチックの表面が活性処理されてなる 特許請求の範囲第1項記載の低反射性プラスチック。

【発明の詳細な説明】

〔産業上の利用分野〕

本発明は表面に反射防止塗膜が形成されたプラスチツク 10 に関し、特に、防汚性と低反射性に優れ、しかも耐擦傷 性をも有する低反射性プラスチツクに関するものであ る。

〔従来の技術〕

一般に、プラスチツク材料、特に透明プラスチツク材料は透明性に加えて、自身の有する軽量、耐衝撃性及び易

加工性などの利点を活かして、建築物の窓・ドアー・間 仕切り、シヨーウインド・シヨーケース、車輛の窓・照 明灯レンズ、2輪車の風防、〇A機器のハウジング、光 学レンズ、メガネレンズなどの広い分野に利用されてい

しかしながら、それらプラスチツク材料からなる成形品 は太陽光、照明光の反射によるギラツキや眩しさ、ある いは周囲の景観が映り、透視性や透明性に支障を与えた り、光の反射により光線透過率が低下して、プラスチツ クを通して見ると明るさが損なわれるという問題があ

従来から、ガラス、ブラスチツクなどの透明物品表面の 低反射化は光学部品を中心に開発が進められてきてい て、通常、プラスチツク成形体の表面に反射防止膜を形 成することによつて行なわれている。反射防止膜は例え ば、MgF₂、Lif、ThF₄、氷晶石などの無機フツ化物、Si Q、SiQ、ZrQ、CeQ、Al, Q、などの金属酸化物を真空 蒸着やスパツタリングなどの方法によつて単層あるいは 複層の塗膜として形成されている。一方、髙分子物質か らなる低反射性処理剤を直接塗布あるいは処理剤中に浸 20 れた低反射性プラスチツクが得られるものである。 漬することによる反射防止塗膜の形成方法ならびに処理 剤が提案されている。しかしながら、かかる処理剤はガ ラス、プラスチックなどの表面への接着性に劣るため、 多くの場合、プレコート層が形成され、その層上に処理 されて、反射防止塗膜として形成される。これらの改良 された反射防止塗膜の形成方法として、例えば、透明材 料、特にプラスチツク基材上に金属酸化物含有組成物を 水を含む条件下で処理してプレコート層を設け、該プレ コート層上に有機ケイ素化合物を含有する組成物からな る反射防止塗膜を形成させる方法(特開昭59-499 60号公報が開示されている。また、本発明者も硬度と 低反射性に優れた反射防止塗膜としてシラン化合物とポ リフルオロ化基含有化合物からなる多層構造の低反射率 塗膜(特開昭59-115840号公報)を提案してい

〔発明の解決しようとする問題点〕

前記の反射防止膜の形成方法において、真空蒸着あるい はスパツタリング法は装置の機構上及びコスト面から適 応物品は小型精密光学部品などに限定されるという制約 があり、更に連続的製造には適していない。

一方前記のどとき公知の低反射処理剤はプラスチツク表 面への接着性は充分でなく、プレコート層の形成を必要 とし、低反射処理工程を煩雑なものとして、コスト的に 不利である。しかも形成されら反射防止塗膜は大気中に 浮遊する塵埃、水滴、油滴などが付着して汚染されると 塗膜の構造特性から通常の洗浄作業によつては容易に除 去されず、例えば強く払拭すると塗膜に傷を生じ、つい には剥離してしまい、耐擦傷性に劣るという問題があ

したがつて、低反射処理工程が簡単であり、しかも形成 50 率化及び防汚性付与、X。Si-A-R。A-SiX。で表わされる

された反射防止塗膜は耐擦傷性と防汚性とに優れている 低反射性プラスチツクの開発が望まれている。

[問題点を解決するための手段]

本発明者は、前記問題点に鑑み、プラスチツク表面に対 して接着性に優れ、しかも形成された反射防止塗膜は耐 擦傷性と防汚性とを満足する低反射処理剤について種々 研究、検討を行なつた。その結果、特定の含フツ素シリ コーン化合物の2種とシリコーン化合物との三成分から なる組成物は反射防止塗膜としてプラスチツク表面に形 10 成されると、前記問題点を解決するに足る塗膜となり得 るという事実を見い出し本発明を完成するに至つたもの である。

而して、上記組成物において、三成分のいずれが欠けて も特性は満足されないが、三成分が含まれることによつ て各種プラスチツクに応用が可能であつて、プラスチツ クの有する透明性、透視性を損なうことなく、塗布、吹 付け、浸漬など既知の簡便な方法によつてプラスチック 表面上に塗膜として形成されることによつて、可視光全 域を平均に低反射化し、しかも耐擦傷性、防汚性にも優

即ち、本発明は、表面に反射防止膜が形成された低反射 性プラスチツクにおいて、下記一般式で表わされる化合 物を含有する反射防止膜組成物からなる塗膜が形成され てなることを特徴とする防汚性・低反射性プラスチツク を提供するものである。

一般式

R_f 1 -A-SiX₃ 5~80重量% X, Si-A-R, -A-SiX, 5~94重量% SiX. 1~90重量%

(但し、式中Aは二価の有機基、Xはハロゲン、

0 II OOR ,

OR、Rは低級アルキル基、R-1はポリフルオロアルキル 基、R,'はフツ素を含有する炭素数2以上の二価の有機 基を示す。)

本発明におけるプラスチックとしては、表面の反射を低 下させる目的から透明プラスチツクであるのが好適であ 40 る。かかる透明プラスチツクとしては、例えば、ポリ (ジェチレングリコールビスアリルカーボネート)、ポ リカーボネート、ポリメタアクリレート、ポリスチレ ン、ポリエステル、ポリウレタン、ポリ塩化ビニル、ジ アリルフタレート樹脂、メラミン樹脂などが挙げられ る。而して、かかる透明プラスチツクのみに限定される ものではない。

本発明の反射防止膜組成物は一般式R,1-A-SiX, X,Si-A -R-²-A-SiX₃、SiX₄で表わされる各化合物の三成分より なるが、R-1-A-Six,で表わされる化合物は塗膜の低屈折

化合物は低屈折率化及び耐擦傷性向上、そしてSiX、は耐 擦傷性向上に有用であつて、とれら三成分が最適な割合 で組合せられることによつて低反射性、防汚性及び耐擦 傷が発現されるものである。

ととで、一般式R.1-A-SiX。

で表わされる化合物は、R₊1は防汚性の付与と、その向上という点でポリフルオロアルキル基であるのが好ましく、エーテル結合が含まれていてもよい。Aは二価の有機基、Xはハロゲン、

* ORであつてRは低級アルキル基である。かかる化合物を 例示すると、

 $R_r(CH_r)_r SiCT_r$, $R_r(CH_r)_r Si(OCH_r)_r$,

 $R_{\epsilon} CONH(CH_{\epsilon})_{s} Si(OC_{\epsilon} H_{s})_{s}$

 R_r CONH(CH₂), NH(CH₂), Si (OC₂ H₅),

 $R_r SO_2 N(CH_3)(CH_2)_2 CONH(CH_2)_3 Si(OC_2 H_3)_3$

 $R_{i}(CH_{i})_{i}OCO(CH_{i})_{i}S(CH_{i})_{i}Si(OCH_{i})_{i}$

 $R_{r}(CH_{s})_{s}OCONH(CH_{s})_{s}Si(OC_{s}H_{s})_{s}$

 $\begin{array}{c} 0 \\ \text{OCR} \\ \\ \text{R}_{\mathbf{f}} \text{COO} \\ \end{array} \begin{array}{c} * \\ \text{HO} \\ \\ \text{R}_{\mathbf{f}} \text{COO} \\ \end{array} \begin{array}{c} * \\ \text{(CH}_{\mathbf{z}})_{\mathbf{z}} \text{Si} \text{(OCH}_{\mathbf{3}})_{\mathbf{3}} \\ \text{(CH}_{\mathbf{3}})_{\mathbf{z}} \text{Si} \text{(OCH}_{\mathbf{3}})_{\mathbf{3}} \\ \text{CF}_{\mathbf{3}} \\ \text{CF}_{\mathbf{3}} \\ \text{CF}_{\mathbf{3}} \end{array}$

 $CF_3CF_2CF_2O+CF-CF_2O-\frac{1}{m}CFCONH(CH_2)_3Si(OCH_3)_3$

(但し、R,はポリフルオロアルキル基、mは1以上の整 数)

などのポリフルオロアルキル基含有シラン化合物、ポリフルオロアルキル基がエーテル結合を有するシラン化合物が挙げられる。

上記一般式R¹-A-SiXで表わされる化合物は反射防止膜 組成物中5~80重量%含まれるのが好ましい。5重量 %以下では防汚性が、また80重量%以上であると耐擦★30

★傷性が低下する。

次に一般式X、Si-A-R、A-A-SiX、で表わされる化合物は、R、がフツ素を含有する炭素数2以上の二価の有機基であつてA、Xは前記と同一である。かかる化合物としては例えば、

 $Cl_3 SiQ_4 (CF_2)_n Q_4 SiCl_3$

 $(CH_3 O)_3 SiC_2 H_4 (CF_2)_n C_2 H_4 Si(OCH_3)_3$

(但し、nは2~14の整数)

などが挙げられる。

上記、一般式X, Si-A-R,²-A-SiX,で表わされる化合物は 反射防止膜組成物中5~94重量%含まれるのが好まし く、5重量%以下であると耐擦傷性が、94重量%以上 であると防汚性が低下する。

更に一般式SiX、で表わされる化合物はXは前記と同一である。この化合物としては

SiCl., Si(OCH,),, Si(OCH, H,),,

☆などを例示するととができる。との一般式SiX、で表わされる化合物は反射防止膜組成物中1~90重量%含まれるのが好ましく、1重量%以下では耐擦傷性が、90重量%以上では低反射性、防汚性が低下する。

上記、三成分を構成する化合物において、それぞれの化 40 合物内で数種が組合わされてもよい。

反射防止膜組成物は上記、三成分を構成する化合物の他 に反射防止膜の特性を向上させる目的で、シリカゾルな どの無機質フィラーや、例えば

Si(OCCH₃)₄
$$\Leftrightarrow$$
 CH₂-CHCH₂O(CH₂)₃Si(OCH₃)₃,

 NH_2 (CH_2), NH(CH_2), Si(OCH_3),,

50 NH₂ (CH₂)₂ Si(OCH₃)₃, CH₂ =CHSi(OCH₃)₃, CH₃ =CHSiCl₃,

CH CH2=CCOO(CH2)3Si(OCH3)3.

7

* HS(CH₂)₃ Si(OCH₃)₃, HCO(CH₂)₃ Si(OC₂ H₅)₃, C1(CH₂)₃ Si (OCH,),,

$-CH_2NH(CH_2)_2NH(CH_2)_3Si(OCH_3)$,

などのシランカップリング剤、あるいは架橋剤、帯電防 止剤、その他の特性改良用の添加剤などが配合、含有さ れてもよい。

反射防止膜組成物は塗膜形成用の処理液として次のよう に調製される。即ち、前記三成分を構成するそれぞれの 化合物を所定の割合に従つて混合して、溶媒中触媒の存 在下に加水分解反応せしめて、部分縮合体となし、溶媒 に溶解された処理液として調製される。かかる加水分解 反応における溶媒はアルコール類、例えば、ブタノー ル、好ましくはtert-ブタノールが用いられ、触媒とし 20 ては塩酸、酢酸あるいは他の有機酸が使用され、反応は 室温にて撹拌することによつて行なわれる。溶媒の量は 調製された処理液のプラスチツク表面への塗布性あるい は形成される塗膜の膜厚が考慮され、部分縮合体が1~ 20重量%、好ましくは2~5重量%となるように調整 される。

かくして調製された塗膜形成用の処理液のプラスチック 表面への塗布方法は、はけ塗り、ロール塗り、スピニン グ、吹付け、あるいは浸漬など既知の方法によつて行な

塗布後は50~150℃の温度で20分以上硬化すると とによつて塗膜が形成される。硬化処理における温度の 設定はプラスチツクの軟化温度との関係において適当に 選定される。形成される塗膜の膜厚は0.2 μ以下、好ま しくは0.05~0.1μであつて、かかる膜厚の調整は塗布 方法の条件によつてなし得るものであり、例えば浸漬法 においては組成物濃度と引上げ速度とによつて決定され る。

プラスチツク表面に形成される塗膜の密着性は上記の方 法によれば実用上は充分であるが、プラスチツク表面を 予め、アルカリ処理、グロー放電処理、プラズマ処理な どの活性処理を施こすことによつて、更に向上せしめる ことができる。

[実施例]

次に、本発明を実施例により具体的に説明するが本発明 はこれら実施例のみに限定されるものではない。尚、実 施例において防汚性・低反射性プラスチツクとしての評 価試験方法は次の通りである。

反射率測定:自記分光光度計正反射光測定付属装置(日 立製作所製:323型)を使用し、波長400nm~70 50 0 nmの入射角5° における平均反射率を測定。

膜厚測定:"タリステツプ"(Rank Taylor Hobson社

10 製)を使用し針圧測定より求める。

耐擦傷性:綿布を500g荷重下、1000回摩擦し傷 の発生の有無を確認

防汚性:油性フエルトペンにて汚染し、1時間放置後、 綿布で払拭し、インクの除去性を確認。

実施例1

(C) Si(OCH,).

下記 (A)~ (C) の化合物とtert-ブタノール250 0gとを混合し、それに1%塩酸水溶液16.2gを加え室 温24時間撹拌しながら反応させて、反射防止塗膜形成 用の処理液を調製した。

(A) R_rC₂H_rSi(OCH₂), 50a (CCで、R,はC,F2...,でnは6~16で平均値9) (B) (CH, O), SiC, H, C, F, , C, H, Si (OCH,),

10q

別にポリ(ジエチレングリコールビスアリルカーボネー ト) 製の平板 (50mm×50mm×30mm) を10% 苛性 ソーダ水溶液に浸漬後、水洗、乾燥して用意し、とれを 上記処理液に浸漬し7.5cm/minの速度で引上げ、室温に て10分間乾燥後、続いて120℃で60分間加熱して 硬化させ、反射防止塗膜を形成した。形成された塗膜の 30 厚膜は0.09μ、波長400 nmから700 nmにおける平均 反射率は片面当り1.7%であつた。また、塗膜の耐擦傷 性試験において傷の発生は全く認められず、防汚性試験 においてはインクは、はじかれ、払拭することによつて

完全に除去することができた。 実施例2~6、比較例1~4

実施例1における〔A〕~〔C〕の化合物の量を第1表 に示す量に変えた他は、実施例1と同様の方法により、 反射防止塗膜形成用の処理液を調製した。次いで、実施 例1と同様に平板に処理して反射防止塗膜の形成された 40 平板を得て、その評価試験を行なつた。試験結果を第1 表に示した。

表

処理液組成 (g)		膜厚	反射 率	耐擦傷	耐汚染		
(A)	(B)	(C)	(μ)	(%)	性※1)	性*2)	
20	60	20	0,09	2.1	A	0	
30	20	50	0.09	2.5	A	0	
75	15	10	0.09	1,5	A	0	
15	80	5	0.9	2.1	A	0	
	(A) 20 30	(g) (A) (B) 20 60 30 20 75 15	(g) (A) (B) (C) 20 60 20 30 20 50 75 15 10	(g) (A) (B) (C) (μ) 20 60 20 0.09 30 20 50 0.09 75 15 10 0.09	(g) 率 (A) (B) (C) (μ) (%) 20 60 20 0.09 2.1 30 20 50 0.09 2.5 75 15 10 0.09 1.5	(g)	

Na.		処理液組成 (g)		膜厚	反射 率	耐擦傷	耐汚染	
NO.		(A)	(B)	(C)	(μ)	(%)	性*1)	性*2)
"	6	15	10	7 5	0.9	2.7	A	0
比較的	利1		80	20	0.09	2.3	A	×
"	2	80	_	20	0.09	1.7	C	Δ
"	3	80	20	-	0.09	1.5	В	Δ
"	4	-	_	_	_	4.0	С	×

*1) A: 傷の発生なし B: 若干の傷の発生あり

C:多数の傷の発生あり

*2) O:完全に除去 Δ:除去性に難点あり

×:除去は困難

*実施例7~8

実施例1 における〔A〕の化合物を第2表に示す量に変 えた他は実施例1と同様の方法により、反射防止塗膜形 成用の処理液を調製した。続いて平板に処理して反射防 止膜の形成された平板を得た。その評価試験を行ない結 果を第2表に示す。

10

* 第 表

10

No.	(A)の化合物	Dの化合物 膜厚 (μ)		耐擦傷性*1)	耐汚染性*2)	
実施例 7	CF ₃ CF ₃ C ₄ F ₇ O+CFCF ₂ O+ ₂ CFCONHC ₃ H ₆ Si(OCH ₃) ₃	0.09	2.0	A	0	
<i>"</i> 8	C4F, C2H4Si(OCH,),	0.09	2.1	A	0	

*1), *2) 前記第1表と同。

実施例9

※ 実施例1における[B]の化合物を CF3 CF3 $(CH_5O)_3SiC_2H_4CFCF_2OC_4H_8OCF_2CFC_2H_4Si(OCH_3)_3$

40

に変えた他は実施例1と同様の方法により、反射防止塗 膜形成用の処理液を調製した。続いて平板に処理して反 30 本発明の防汚性・低反射性プラスチツクは、従来、得ら 射防止膜の形成された平板を得た。形成された塗膜の膜 厚は0.09μ、平均反射率は片面当り1.6%であつた。ま た塗膜の耐擦傷性試験において傷の発生は全く認められ ず、防汚性試験においてはインクは、はじかれ、払拭す ることによつて完全に除去することができた。

実施例10~11

実施例1における平板をポリメタクリル製及びポリウレ タン製の平板とした他は実施例1と同様に処理して、反 射防止塗膜の形成された平板を得た。その評価試験を行 ない、結果を第3表に示した。

> 3 表

No.	平板	膜厚 (μ)	反射率 (%)	耐擦傷性*1)	耐汚染 性 米 2)
実施 例10	ポリメタア クリル製	0.09	1,8	A	0
実施 例11	ポリウレタ ン製	0.09	1.6	A	0

*1), *2) 前記1と同

[発明の効果]

れなかつた防汚性と低反射性という両特性を同時に満足 させ、しかも耐擦傷性にも優れているという効果が認め られるものである。

特にプラスチツク表面に形成される反射防止塗膜は塗膜 の形成工程が簡略化され、コスト的にも有利であるとい う効果をも有するものである。